

4. 電子情報通信分野の概観

○全般	日本	米国	欧洲	中国	韩国
◎	72	156	78.5	12	25
○	95	30	89	66	84
△	26	5	23.5	91	74
×	2	4	4	23	12

○研究水準

○	28	57	40.5	5	5
○	31	6	19.5	26	28
△	5	1	5	29	31
×	1	1	0	4	1

○技術開発水準

○	日本	米国	欧洲	中国	韩国
◎	22	55	21	3	8
○	36	8	36.5	20	32
△	7	1	6.5	35	20
×	0	1	1	6	5

○産業技術力

○	日本	米国	欧洲	中国	韩国
◎	22	44	17	4	12
○	28	16	33	20	24
△	14	3	12	27	23
×	1	2	3	13	6

出展: 科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.146 科学技術の状況に係る総合的意識調査(定点調査2010)

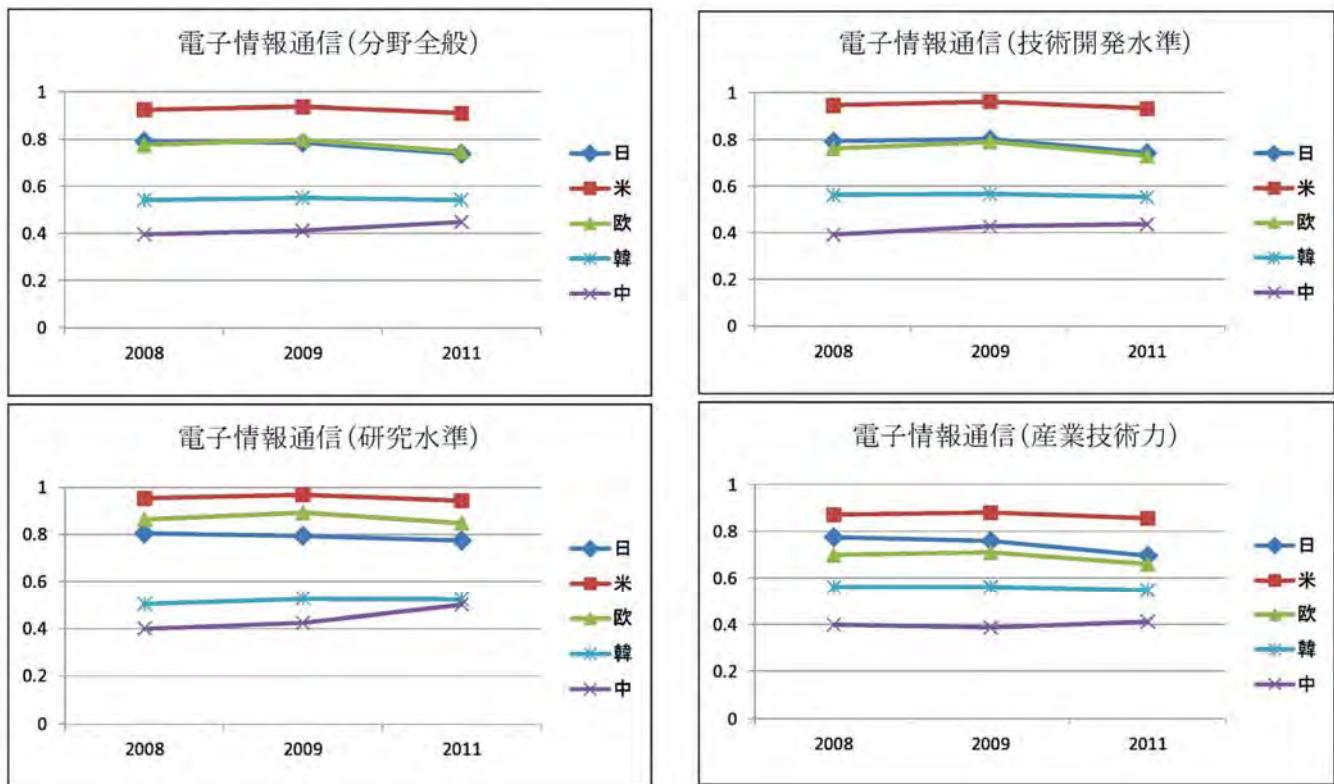
図表 2-9 重点推進 4 分野の戦略重点科学技術の研究の水準・活動度・必要な取り組み

分野・戦略重点科学技術		必要度・取り組み		基盤整備研究資金(16.9%)	
A01	生命プログラム再構築技術	人材育成(44.1%)	人材育成(33.3%)	人材育成(26.3%)	人材育成(21.7%)
A02	臨床研究・臨床への導入・実証研究	人材育成(38.6%)	人材育成(34.9%)	人材育成(15.2%)	人材育成(16.3%)
A03	標的治療等の革新的がん医療技術	人材育成(38.6%)	人材育成(34.9%)	人材育成(26.3%)	人材育成(21.7%)
A04	新規・再興感染症免疫科学技術	人材育成(38.6%)	人材育成(34.9%)	人材育成(15.2%)	人材育成(16.3%)
A05	安全な食料の生産・供給科学技術	人材育成(38.6%)	人材育成(34.9%)	人材育成(26.3%)	人材育成(21.7%)
A06	生物機能活性の物質資源・環境改善科学技術	人材育成(38.6%)	人材育成(34.9%)	人材育成(26.3%)	人材育成(21.7%)
A07	世界最高水準のライフルエンシス・コンピュータ技術	人材育成(38.6%)	人材育成(34.9%)	人材育成(26.3%)	人材育成(21.7%)
B01	世界最高水準の次世代スマートフォン・ヨーロッパ技術	研究資金(10%)	人材育成(7%)	研究資金(34.4%)	人材育成(23.4%)
B02	次世代化を担う高密度TFT・AMOLED・IGZO技術	人材育成(7%)	人材育成(7%)	人材育成(26.3%)	人材育成(21.7%)
B03	超低圧化・低消費電力及び設計・製造技術	人材育成(26.9%)	人材育成(26.9%)	人材育成(26.3%)	人材育成(21.7%)
B04	ディスプレイ・フレーバーレジ・超高速データバスの技術	研究資金(23.9%)	人材育成(23.9%)	研究資金(14.3%)	人材育成(14.3%)
B05	情報家庭や街で生活に役立つIoT・シート技術	人材育成(56.7%)	人材育成(56.7%)	人材育成(26.3%)	人材育成(26.3%)
B06	世界標準を目指すソフтверア開発支援技術	人材育成(21.8%)	人材育成(21.8%)	人材育成(17.5%)	人材育成(17.5%)
B07	大量の生活情報を便利・快適な次世代ネットワーク技術	人材育成(45.2%)	人材育成(45.2%)	研究資金(14.7%)	研究資金(14.7%)
B08	生活を豊かにするビッグデータ・AI技術	人材育成(45.2%)	人材育成(45.2%)	人材育成(14.7%)	人材育成(14.7%)
B10	安全・安心な社会実現のセキュリティ技術	人材育成(47.1%)	人材育成(47.1%)	研究資金(25%)	研究資金(25%)
C01	人工衛星からの地球温暖化の観測科学技術	人材育成(32.1%)	人材育成(32.1%)	人材育成(26.5%)	人材育成(26.5%)
C02	スマートを用いた気候変動予測の科学技術	人材育成(28.6%)	人材育成(28.6%)	人材育成(26.5%)	人材育成(26.5%)
C03	地熱温漬化技術リサイクル・資源科学技術	人材育成(35.5%)	人材育成(35.5%)	分野間連携(17.5%)	分野間連携(17.5%)
C04	世界を生きる化学物質リスク評価科学技術	人材育成(28.9%)	人材育成(28.9%)	産学官連携(17.8%)	産学官連携(17.8%)
C05	国際標準化・規格利用・有効性評価技術	研究資金(21.1%)	研究資金(21.1%)	研究資金(22.4%)	研究資金(22.4%)
C06	効率的・コネルギーを構築するためのハイオースト利用技術	人材育成(35.7%)	人材育成(35.7%)	研究資金(16.6%)	研究資金(16.6%)
C07	健全な水循環を保ち自然共生する社会の設計	人材育成(42.1%)	人材育成(42.1%)	研究資金(21.1%)	研究資金(21.1%)
C08	多様多様な生物による生体系の保全・再生技術	人材育成(62.5%)	人材育成(62.5%)	研究資金(15.5%)	研究資金(15.5%)
C09	化学生物リサイクル管理・社会に普及する技術	人材育成(59.5%)	人材育成(59.5%)	人材育成(26.8%)	人材育成(26.8%)
C10	3Dに適した生産・品質・システムの設計科学技術	人材育成(59.5%)	人材育成(59.5%)	分野間連携(17.3%)	分野間連携(17.3%)
C11	人文社会学と融合する情報研究・人材育成	人材育成(59.5%)	人材育成(59.5%)	人材育成(23.4%)	人材育成(23.4%)
D01	クリーンエネルギー・コスパ削減の革新的材料技術	人材育成(28.6%)	人材育成(28.6%)	分野間連携(20%)	分野間連携(20%)
D02	希少資源・不足資源で構成される革新的エレクトロニクス	人材育成(32.9%)	人材育成(32.9%)	研究資金(16.7%)	研究資金(16.7%)
D03	生活の安全・安心を実現する革新的ナノ材料技術	人材育成(35.7%)	人材育成(35.7%)	人材育成(17.9%)	人材育成(17.9%)
D04	イバペーション・創出の中核となる革新的材料技術	人材育成(47.4%)	人材育成(47.4%)	人材育成(23.1%)	人材育成(23.1%)
D05	デバイス性能限界突破の先端的エレクトロニクス	人材育成(34.4%)	人材育成(34.4%)	分野間連携(25.7%)	分野間連携(25.7%)
D06	細胞診断と疾患早期検出のための研究開発	人材育成(38.7%)	人材育成(38.7%)	基盤整備(17.7%)	基盤整備(17.7%)
D07	ナノテクノロジーによる革新的な研究開発	人材育成(34.3%)	人材育成(34.3%)	産学官連携(22.9%)	産学官連携(22.9%)
D08	イバペーション創出拠点のナノテクノロジー開拓	人材育成(36.8%)	人材育成(36.8%)	研究資金(22.1%)	研究資金(22.1%)
D09	ナノ電子開拓・加工技術	人材育成(38.5%)	人材育成(38.5%)	研究資金(16.4%)	研究資金(16.4%)
D10	X線自由電子レーザー・開発・共同				

注1: 人材とは「人材育成と開拓」、産学官とは「産学官の連携強化」、分野とは「分野間の連携強化」、拠点は「開拓拠点」、開拓印は「開拓する拠點の強化・創設」がある。

注2: 1記以外の選択肢に「開拓」、「開拓する拠點」、「開拓する拠點の強化・創設」がある。

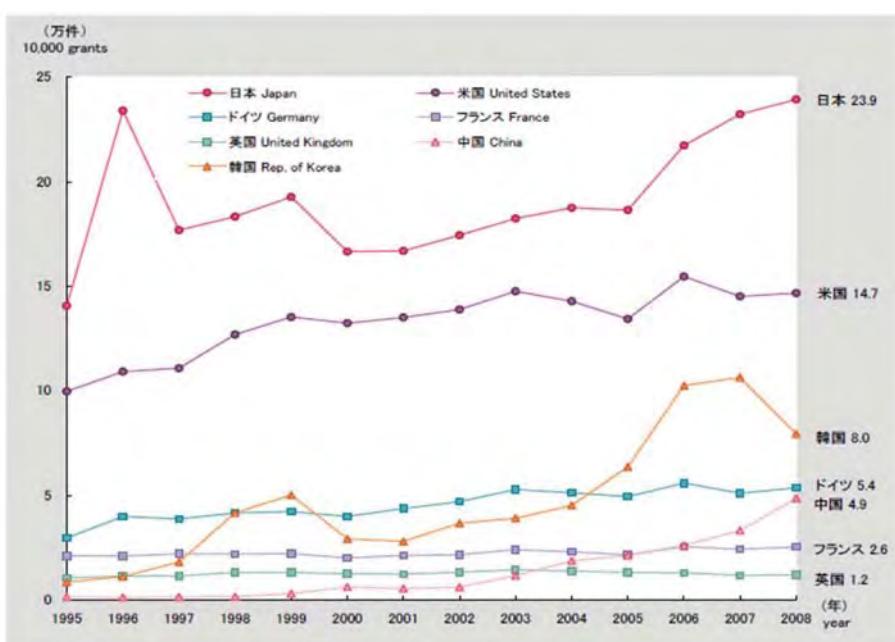
電子情報通信分野の動向



出展: CRDS 調査報告書「日本の専門家による科学技術力の国際比較」CRDS-FY2011-RR-03

39

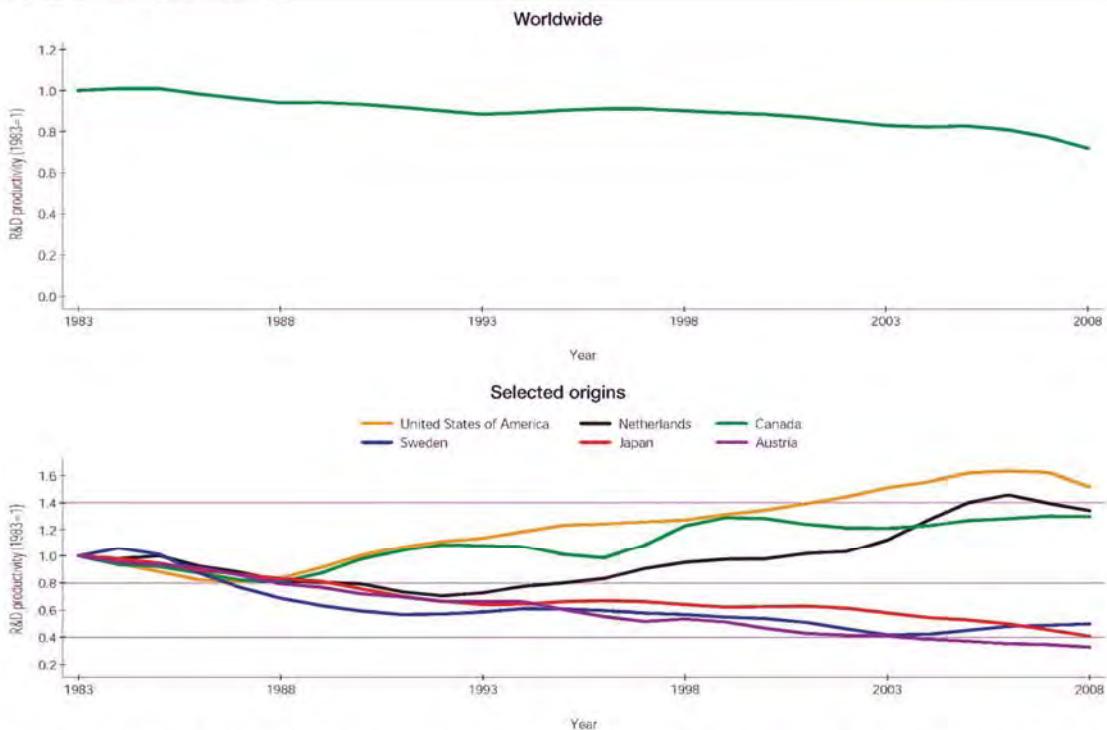
主要国等の特許登録件数の推移



注) 出願人の国籍別に、自国及び他国において登録された件数とPCT国際出願に基づく登録件数を合計したものである。

資料: WIPO Statistics Database, September 2010
「Patent grants by country of origin and patent office (1995-2008)」

Figure 7 R&D productivity



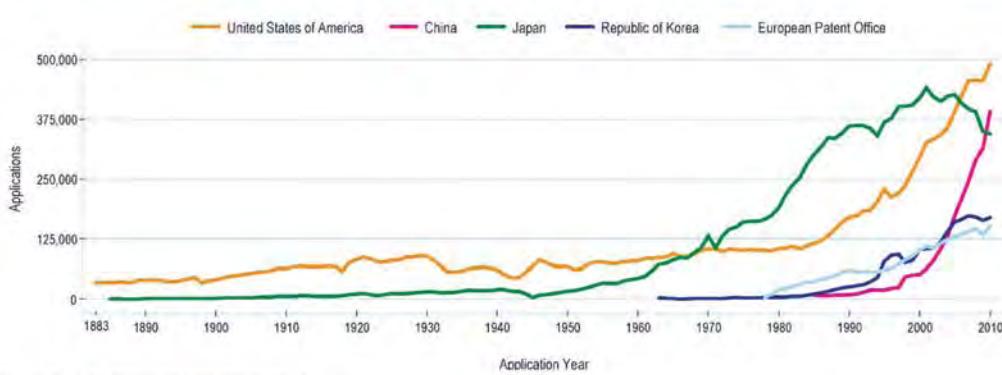
Note: Data from 20 countries are included in the worldwide figure. These countries accounted for 63% of first filings worldwide in 2008. The figure includes all the main R&D spenders except China, the Republic of Korea and the Russian Federation, because of insufficient R&D data. Productivity is defined as first filings over business sector R&D expenditure in constant 2005 PPP dollars. R&D data are lagged by one year to derive the productivity ratio which is presented as a three-year moving average.

Source: WIPO Statistics Database and OECD, October 2011

出展: World Intellectual Property Indicators 2011, WIPO
<http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html>

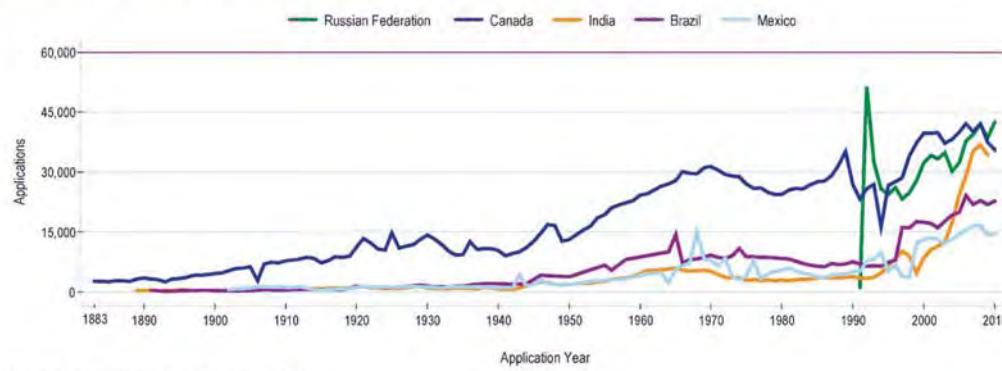
41

Figure A.2.1.1 Trend in patent applications at the top five offices



Source: WIPO Statistics Database, October 2011

Figure A.2.1.2 Trend in patent applications at selected offices



Source: WIPO Statistics Database, October 2011

出展: World Intellectual Property Indicators 2011, WIPO
<http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html>

42